

平成24年11月1日



日米欧中韓の商標五庁の新たな協力枠組みを創設します ～第1回商標五庁会合の結果について～

この度、商標分野において、日米欧の三庁に、韓国、中国をメンバーに加えた「商標五庁」の新たな協力枠組みが創設されることとなりました。

10月30日から31日にかけて第1回商標五庁会合がスペイン・バルセロナで開催され、日米欧中韓の商標五庁間で知財分野における商標の国際的な協力の必要性が共有されるとともに、今後商標五庁間で国際協力を推進していくことが確認され、共同声明が採択されました。

日本国特許庁は、我が国企業の商標が世界各国で適切に保護、活用される環境整備に向け、商標五庁の枠組みでの国際協力等を推進することにより、我が国企業のグローバルな事業活動の支援に努めてまいります。

1. 背景

経済のグローバル化が進み企業間の競争が国際的にも激しさを増す中で、高い価値を有する国際的なブランドの確立及び保護のため、商標権の活用がますます重要になってきています。企業の国際展開を支援するためには、世界各国で安定した商標権を速やかに取得でき、適切に保護されるような環境を整えることが不可欠です。

一方、中国における商標登録出願件数は年間142万件（2011年）で世界第1位^{*1}となっており、その件数はさらに増加傾向を示しております。また、近年、世界的に我が国の地名や地域ブランド等を含む著名商標等が第三者によって出願、登録される事例（冒認商標）が顕在化しております。

これまで、商標分野においては、日米欧の三庁における協力を2001年から推進してきたところですが、この度、日米欧三庁に、韓国、出願件数が急増している中国をメンバーに加えた「商標五庁」の新たな協力枠組みが創設されることとなりました。

^{*1}商標登録出願件数は、世界第1位の中国は第2位の米国（39.9万件）の3倍以上。第3位は韓国（12.3万件）。日本は第4位（10.8万件）。(件数はいずれも2011年)

2. 結果概要

10月30日から31日にかけて、スペイン・バルセロナにおいて日本国特許庁、米国特許商標庁、欧州共同体商標意匠庁、中国国家工商行政管理総局、韓国特許庁の商標関係の代表が集まり、第1回商標五庁会合が開催されました。

日米欧中韓の商標五庁間で知財分野における商標の国際的な協力の必要性が共有されるとともに、今後商標五庁間で国際協力を推進していくことが確認され、共同声明が採択されました（参考資料参照）。

今次会合では、商標における制度・運用の分野、各庁の審査処理の分野とユーザーへの有効なサービスの提供の分野に関する協力プロジェクトを推進していくことが合意されるとともに、同時に開催された各国のユーザーとの会合において、この協力プロジェクトに関する議論が行われました。

（1）商標に関する主な議論

冒認商標問題の顕在化を受け、我が国特許庁は、この問題に関する協力プロジェクトにおいて、各庁の制度や運用について情報の共有を図り、効果的な対応策を得るための共同研究を進めていくことを提案し、五庁間で合意がなされました。

また、図形商標のイメージサーチに関する研究の協力プロジェクトについて、我が国特許庁がリードしていくこととなりました。

（2）意匠に関する主な議論

上記会合に並行して、意匠分野の専門家による会合も行われ、画像デザイン等に関する各庁の運用や最近の取組について各庁間で議論が行われるとともに、ユーザーとの会合も開催されました*²。

*²意匠分野の専門家による会合は、中国国家工商行政管理総局が意匠を所管していないことから、日米欧韓の四庁により実施。

3. 今後の取組

特許庁は、我が国企業の商標が世界各国で適切に保護、活用される環境整備に向け、商標五庁の枠組みでの国際協力等を推進することにより、我が国企業のグローバルな事業活動の支援に努めてまいります。

【参考】第1回商標五庁会合 共同声明

（本発表資料のお問い合わせ先）

特許庁 総務部 国際課長 岩崎 晋

担当：高橋、大峰

電話：03-3581-1101（内線 2566）

03-3581-1898（直通）